



苏州萃智光电设备有限公司
VIOO® Instruments

ITC-5/10-D

薄膜沉积控制仪

THIN FILM DEPOSITION CONTROLLER



专利技术 (CN110836832A) 保证高精度的速率和膜厚测量
集成薄膜沉积监测与控制等PLC功能, 实现对整个沉积过程的控制

产品参数

通道参数	晶振测量通道数	5或10
	最多共蒸数量	4
	晶振频率识别范围	0.5-15MHz
测量精度	频率测量精度	±0.001Hz
	速率测量精度	±0.001Å/s
	膜厚测量精度	±0.01Å
输入/输出	模拟输入/输出	8AD,8DA, 4TC 0-10v 可拓展至16/16/8
	数字输入/输出	16/16 可拓展至32/32
	输出类型	EC2-5NU继电器 MOS管继电器 直流固态继电器 60W,125VA,2A,220VDC,250VAC
	温度测量	4路; 精度0.1°C TC类型: B,E,J,K,N,R,S,T,CJ补偿型 可拓展至8路
通讯	通讯接口类型	RS485、RS232、以太网口
	窗口软件	ITC-5-D
存储能力	处理层	8×32层, 99种材料
人机交互	触摸屏	7寸全彩高清
其他	供电电源	88-264VAC,25W
	仪器尺寸(长x宽x深)	133mmx482mmx250mm(19英寸标准机箱)
	配件	振荡器、石英晶振、射频信号线

刘经理

☎ 13291513808

✉ liuzheng@f-sheng.com

🏠 苏州萃智光电设备有限公司

📍 江苏省苏州市吴江区黎里镇汾湖大道1198号



苏州萃智光电设备有限公司
VIOO® Instruments

产品功能

- ◆ 兼容单、双及旋转多探头, 识别晶振故障并排除, 自动切换晶振
- ◆ 高分辨率模式, 适用于纳米技术、MBE等沉积实验
- ◆ 独有间歇模式增加晶振寿命
- ◆ 多个I/O、A/D、D/A、TC端口, 可控制蒸发源、晶振和主挡板
- ◆ PID温度、PID速率及串联控制功能, PID参数优化功能
- ◆ 可编辑功率和温度梯度预热及降温功能
- ◆ 逐层沉积、多源共蒸等自动化功能
- ◆ 带或不带热电偶的蒸发源都可支持
- ◆ 支持固定、继电器切换的蒸发源, 支持电子束蒸发及坩埚切换
- ◆ 可自定义按键功能
- ◆ 可本地保存工艺参数和互锁设置, 不需要额外编程
- ◆ 仿真模拟功能便于上位机开发
- ◆ PC客户端、数据处理等增值功能

关于我们

苏州萃智光电设备有限公司成立于2018年, 位于江苏省苏州市。公司致力于为OLED、QLED、OPV、钙钛矿、光学薄膜、生物制药、医疗健康和环境监测等领域的工业制造和学术研究人员, 提供精确、稳定、智能的薄膜沉积控制仪。公司拥有5000平米研发中心, 有不同类型的薄膜沉积系统, 为薄膜沉积控制仪提供测试平台: OLED中试线、G2 OLED生产线、钙钛矿蒸镀中试线、PECVD、磁控溅射、PEALD等。

我们将以深厚的经验指导您, 如何选择一台专业的薄膜沉积控制仪!

产品展示



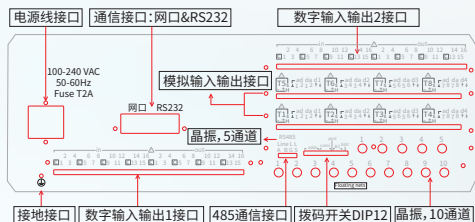
主机



震荡器



软件界面



应用场景

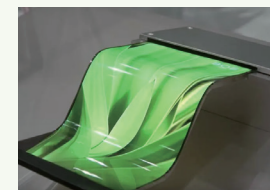
半导体行业中, 利用热蒸发、磁控溅射、分子束外延(MBE)、PECVD、MOCVD等设备, 制备有机、无机、金属等薄膜的需求明显。膜层厚度从几埃到几百纳米, 也会有2-4种材料的掺杂沉积, 这就增加了控制每种材料的速率和厚度的难度。使用ITC-5/10-D薄膜沉积控制仪, 用户只需预先设定沉积参数, 之后由软件控制自动或全自动的完成蒸发过程。



光学镀膜



光伏组件



显示面板